

加藤 政博 広島大学/分子科学研究所

SPring-8 vs. UVSOR

UVSOR



SPring-8 (http://www.spring8.or.jp) (C=1400m, E=8GeV, Exo=5.9nm-rad)

UVSOR Synchrotron, Institute for Molecular Science







Synchrotron vs. Linac (2)



Typical Energy Ranges of Photon Beams from Synchrotrons



大は小を兼ねるが・



The First Light of UVSOR in 1983

Upgrade History of UVSOR UVSOR-I UVSOR-II UVSOR-III 4 Undulators 2 Undulators **6 Undulators** 12 Hours Time 9am 27 nm-rad 160 nm-rad 17 nm-rac 1983-2003 2003-2012 2012-

$\begin{array}{ll} UVSOR\text{-}I \Rightarrow UVSOR\text{-}II \\ \textbf{2^{nd} Gen.} \Rightarrow \textbf{3^{rd} Gen.} \end{array}$

•Brilliance Upgrade by improving Magnetic Lattice (from 160nm-rad to 27nm-rad)

•Increase of Straight Sections and Undulators (from 2 to 4)

•Construction of Undulator Beam-lines (BL3U, BL6U, BL7U)

Upgrade of Magnetic Lattice

low- \mathcal{E} , more straight sections, low- β_v at s.s.

$\begin{array}{ccc} \text{UVSOR-I} & \rightarrow & \text{UVSOR-II} \\ \text{(April, 2003)} \end{array} \end{array}$

UVSOR-II \Rightarrow UVSOR-III 3rd Gen. \Rightarrow 3.5th Gen.

•Make all four long straight sections available for undulators (by moving the injection point) <2010>

•Further Brilliance Upgrade (by intoroducing combined function bending magnets); from 27nm-rad to ~15nm-rad <2012>

• Top-up operation (constant intensity operation) <2010>

Towards Top-Up Injection

Energy Upgrade of Booster Synchrotron and BT completed in 2006, 2007

Reinforcement of Radiation Shielding in 2006

Improvements in Beam Monitor System & Control System in 2008

New 4m Straight Section by moving Injection Point

Apr, 2010

18

Further Emittance Upgrade by Combined-func. Bends.

In 2012

Bending radius	2.2 m
Magnetic Length	1.728 m
Bending Angle	45 deg
Field Index (n)	3.36
K1(pole shape)	-1.2 m ⁻¹
K2(edge shape)	-2.43x2 m ⁻²
Pole Gap (Min.)	48 mm

SR Spectra of UVSOR-III

Year

(経済教室) 老朽化するインフラ(下) 長期の社会コスト減 重視を 一 予防保全、長寿命化を左右 中村光・名古屋大学教授 (2019/2/26付日本経済新聞記事より抜粋)

「最後に新設構造物の問題にも触れたい。無駄を省き最適化したものを作る ことがよいとされていたが、その考えを今後見直すべきではないか。使用期 間が短ければ、ある機能に特化しその最適化を求めることが合理的だろう。 しかしインフラは100年以上使うものだ。その間に社会状況が変わり、社会 が求める機能も変化もしくは新たな事項が付け加わる可能性が高い。従来は 成長過程で求められる機能に最適化するようにインフラを廃棄し新設するこ とが社会の成長を促した。しかし長寿命化社会では、時には無駄な物を許容 する「冗長性」のある構造物を建設し、社会の変化に合わせてインフラに少 し手を加えるだけで十分な機能を発揮し続けて長く使える構造物が望ましい 場合もある。既設・新設インフラともに発想の転換が求められる。」

ビームライン**14**本 うちアンジュレータ 6本

Beamline	Optics	Energy Range	Targets	Techniques
BL1B	Martin-Puplett FT-FIR	0.5-30 meV	Solid	Reflection/Adsorption
BL6B	Michelson FT-IR	4 meV-2.5 eV	Solid	Reflection/Adsorption
BL7B	3-m normal incidence	1.2-25 eV	Solid	Reflection/Adsorption
BL3B	2.5-m off-plane Eagle	1.7-31 eV	Solid	Reflection/Absorption
BL5B	Plane grating	6-600 eV	Solid	Calibration/Absorption
BL2B	18-m spherical grating (Dragon)	23-205 eV	Solid	Photoionization Photodissociation
BL4B	Varied-line-spacing plane grating (Monk-Gillieson)	25 eV-1 keV	Gas, Liq. Solid	Photoionization, XAFS Photodissociation, XMCD
BL2A	Double crystal	585 eV-4 keV	Solid	Reflection/XAFS
BL1U	Tandem undulators/ Free electron laser	1.6-13.9 eV	Gas Solid	Laser Compton Scattering Orbital Momentum Light
BL7U	10-m normal incidence (modified Wadsworth)	6-40 eV	Solid	Photoemission
BL5U	Varied-line-spacing plane grating (Monk-Gillieson)	20-200 eV	Solid	ARPES Spin-resolved ARPES
BL6U	Variable-incangle-varied- line-spacing plane grating	40-700 eV	Solid	ARPES XAFS / XPD
BL4U	Varied-line-spacing plane grating (Monk-Gillieson)	50-700 eV	Gas, Liq. Solid	XAFS Microscopy (STXM)
BL3U	Varied-line-spacing plane grating (Monk-Gillieson)	60-800 eV	Gas, Liq. Solid	XAFS / Photoemission Photon-emission

1B	テラヘルツ時分割測定、R&D		
6B	THz-IR顕微分光、ユーザー開拓		
7B	Single bunch:前置鏡冷却なしで供用		
3B	材料評価でニーズがある		
5B	システム高度化へ		
2B	有機固体: 競争力低下		
4B	楕円偏光: XMCD		
2A	-4 keV迄のXAS測定, 素子・分析器R&D		
1U	先進光源開発:新たなユーザー開拓		
7U	超高分解能ARPES		
5U	微小領域ARPES, スピン分解開発中		
6U	広角取込軟X線ARPES → PMM稼働開始		
4U	液体試料in situ, Liも対象, フル稼働		
3U	液体試料in situ/operando XAS		

Photoelectron Momentum Microscope

表面真空学会2020 2020.11.19

Photoelectron Momentum Microscope

2020.11.19

Scanning Transmission X-ray Microscopy: STXM

- High spatial resolution (20 nm~)
 - Local X-ray absorption spectroscopy
- High transmittance
 - Non-destructive observation by CT (3D)
 - Lower radiation dose than electron beam
 - In-situ Observation
 - <u>Samples in air, in solution or in vacuum</u>
- Used in soft X-ray region
 - Absorption edges: light elements and transition metals

応用研究例

Diffraction Limit ?

Coherence of Synchrotron Radiation

M.K. et al. Sci. Rep. 7, 6130 (2017)

Double-slit Diffraction of Helical Undulator Radiation

Interference between harmonic radiations from helical undulators in tandem

M.K. et al. Sci. Rep. 7, 6130 (2017)

特集

84 ● 放射光 March 2018 Vol.31 No.2

渦放射光の生成とその応用の試み

保坂将人

名古屋大学シンクロトロン光研究センター 〒464-8603 名古屋市千種区不老町

金安達夫

九州シンクロトロン光研究センター 〒841-0005 鳥栖市弥生が丘 8-7

加藤政博

自然科学研究機構分子科学研究所 〒444-8585 岡崎市明大寺町字西郷中38 総合研究大学院大学 〒240-0193 神奈川県三浦郡葉山町

e⁻ħω

O. Chubar et al., NIM A 435 (1999) 495 S. Sasaki & I. McNulty, PRL 100, 124801 (2008) J. Bahrdt et al., PRL. 111, 034801 (2013) M. K. et al., PRL 118, 094801 (2017) M. K. et al., SREP 7, 6130 (2017) Harmonics of Helical Undulator Radiation = Optical Vortex carrying Orbital Angular Momentum

Vector Beam from Undulator

S. Matsuba et al., Appl. Phys. Lett. 113, 021106 (2018)

(a)

トピックス

タンデムアンジュレータによる放射光ベクトルビーム の生成

松葉俊哉 高輝度光科学研究センター 〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

藤本將卸 自然科学研究機構 分子科学研究所 極端禁外光研究施設 〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 保坂将人 名古屋大学シンクロトロン光研究センター 〒464-8603 名古屋市千種区不老町

加藤政博 自然科学研究機構 分子科学研究所 極端紫外光研究施設 〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 広島大学放射光科学研究センター 〒739-0046 広島県東広島市鏡山2-313

Vector Beam from Tandem Undulator at UVSOR BL1U

S. Matsuba et al., Appl. Phys. Lett. 113, 021106 (2018)

Brumer-Shapiro $(3\omega_1/\omega_3)$ Scheme

L. Zhu et al., PRL 79 4108 (1997)

Wave Packet Interferometry Scheme

"Double-pulse" structured light from Tandem Undulator

Tandem Undulator N-period Shifter N-period

放射光による原子のコヒーレント制御

金安達夫

九州シンクロトロン光研究センター 〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘 8-7 分子科学研究所 〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38

彦坂奏正

富山大学 教養教育院 〒930-0194 富山県富山市杉谷2630

加藤政博

Delay between two wave packets can be

controlled by the phase shifter magnet

広島大学 放射光科学研究センター 〒739-8526 広島県東広島市鏡山 2-313 分子科学研究所 〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38

A pair of N-cycle wave packets 放射光 Sept. 2020 Vol.33 No.5 ●

1

Incoherent Radiation from a bunch of electrons

Y. Hikosaka et al., Nat. Commun. 10, 4988 (2019)
T. Kaneyasu et al., Phys. Rev. Lett. 123 233401 (2019)

Coherent Control of Atoms

using "double-pulse" structured light from Tandem Undulator

Effect of e-Beam Emittance

Simulation

J. Synchrotron Rad. (2017). 24, 934-938

Diffraction-limited VUV LS ? $hv \leq 100[eV]$ Undulator Radiation $h\nu[\text{keV}] = \frac{0.95E_e^2[\text{GeV}]}{(1+K^2/2)\lambda_u[\text{cm}]} \qquad \left(K = \frac{eB_0\lambda_u}{2\pi mc} \approx (1 \sim 5)\right)$ $h\nu = 0.1$ [keV] = 0.1[Kev] $K \approx 1.5 \qquad \Rightarrow \qquad E_e[GeV] \approx 1[GeV]$ $\lambda_{\mu} \approx 5[cm]$ $\varepsilon \leq \frac{\lambda}{4\pi} = \frac{12.4[nm]}{4\pi} \implies \varepsilon \approx 1[nm]$

Diffraction-Limited Light Sources ?

KEK ATF Damping Ring

http://wwwatf.kek.jp/atf/introduction.h

Major Performance ;				
Beam energy :	1.28 GeV			
Beam intensity single bunch operation :	1.0x10 ¹⁰ electrons/bunch			
multi bunch operation :	0.7x10 ¹⁰ electrons/bunch x 20 bunch			
Beam reputation :	$0.7\sim 6.4~ ext{Hz}$			
X emittance	1.0x10 ⁻⁹ rad.m (at 1.28GeV)			
(extrapolated to 0 intensity):				
Y emittance	1.0x10 ⁻¹¹ rad.m (at 1.28GeV)			
(extrapolated to 0 intensity) :				
Typical beam size :	70µm x 7µm (rms horizontal x rms vertical)			

tm

Y. Honda et al., PRSTAB 6 092802 (2003)

Construction Cost of Synchrotron Facility

• Total Cost = Building + Injector + Synchrotron + Beam-lines

- Building \doteqdot Injector \leftrightarrows Synchrotron \sim [Beam-lines]
 - E_b~500MeV
 - Building ≒ Injector ≒ Synchrotron ~ 1B¥
 - E_b~1GeV
 - Building ≒ Injector ≒ Synchrotron ~ 2B¥
 - • •
 - Cost \propto Electron Energy

Full-energy Injector for VUV Ring

Number of electrons in the storage ring

$$I_{b} = N_{e} e f_{rev}$$

$$I_{b} = 300[mA]$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} [C]$$

$$f_{rev} = c / L = 3 \times 10^{8} [m / \sec] / 53[m] = 5.6 \times 10^{6} [Hz]$$

Number of electrons in the storage ring

$$N_e = 3 \times 10^{11}$$

Beam Filling Time $\sim 1000 \text{ sec} (0 \text{ mA to } 300 \text{ mA})$

Requirements for the injector

 $\frac{\Delta N_e}{\Delta T} = 3 \times 10^{11} / 1000 = 3 \times 10^8 \implies 1 \times 10^9 [\text{electrons/sec}] \quad \text{(Considering efficiency)}$ E = 750[MeV] $\varepsilon <\sim 100 \times 10^{-9} [m]$ $\Delta \gamma / \gamma <\sim 10^{-3}$

UVSOR Facility

 $750 \text{MeV} / (10 \sim 100) \text{MeV/m} = 7.5 \sim 75 \text{ m}$